第4級アンモニウム塩を含む非懸濁浴からのZn-AlOx(OH)。複合電析

Composite Electrodeposition of Zn-AlO_x(OH)_y Film from Non-Suspended Solution Using Quaternary Ammonium Salt

一寸木健太¹⁾,渡辺宣朗²⁾,小岩一郎³⁾,矢部一博⁴⁾ Kenta Chokki¹⁾, Nobuaki Watanabe²⁾, Ichiro Koiwa³⁾, Kazuhiro Yabe⁴⁾

1) 関東学院大学工学部物質生命科学科小岩研究室, 〒236-8501 横浜市金沢区六浦東 1-50-1

1) Koiwa Laboratory, College of Engineering, Kanto Gakuin University, Kanazawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 236-8501,

Japan

2) 関東学院大学工学総合研究所, 〒236-8501 横浜市金沢区六浦東 1-50-1

2) Institute of Engineering, Kanto Gakuin University

1-50-1, Mutsuurahigashi, Kanazawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 236-8501, Japan

3) 関東学院大学理工学部小岩研究室, 〒236-8501 横浜市金沢区六浦東 1-50-1

3) Koiwa Laboratory, College of Science and Engineering, Kanto Gakuin University 4) 沖エンジニアリング株式会社

4) Oki Engineering Co., Ltd., 3-20-16 Hikawadai, Nerima-ku, Tokyo 179-0084, Japan

Corresponding author: f1146059@kanto-gakuin.ac.jp

キーワード [非懸濁浴, Zn-Al 酸化薄膜, 第4級アンモニウム塩]

1. 緒言

複合電析は,薄膜中に様々な機能を付与でき る電析法である。通常, 微粒子を電解液中に懸 濁させ電析の際にその微粒子を取り込む。しか し,問題点として,微粒子が凝集しやすく,薄 膜中に微細かつ均一な状態で共析が困難であ り、電解浴の管理を行う際のろ過が難しくなる。 一方,従来の複合電析の問題点を解決できるこ とが期待されている非懸濁浴からの複合電析 として Zn-Al₂O₃ 電析が報告されている¹⁾。本研 究では非懸濁浴からの Zn-Al₂O₃ 複合電析の検 討を行い、電析時に Al₂O₃を共析させる効果の ある第4級アンモニウム塩である塩化セチルピ リジニウムを添加し,添加剤が膜質に与える影 響を走査型電子顕微鏡(SEM)、エネルギー分散 型 X 線分析(EDS)、透過型電子顕微鏡(TEM)を 用いて解析した。

2. 実験方法

Table.1に建浴組成及び実験条件を示した。 基板として銅(10×5 mm)を使用し、電析浴は、 ZnSO₄ • 7H₂O 0.52 mol/L, Al₂(SO₄)₃ • 14~18H₂O 0.079 mol/L を純水に溶解させて作製した。添加 剤としては Fig.1 に示した第4級アンモニウム 塩である塩化セチルピリジニウム(C21H38NCl) (以下 HDPC と示す)および塩化ベンゼトニウム (C₂₇H₄₂ClNO₂) (以下 BEC と示す)、ベンジルジ メチルステアリルアンモニウムクロリド (C23H42CIN) (以下 BDTAC と示す)を用いた。pH は 2.5 に調整した。 電析時間は 0.5~5 min で行 い、電析電位は-2.5 ~ -1.1 V(Ag/AgCl)に設定し た。電析浴は N2 バブリングを 1 時間行い, 溶 存酸素量を 0.5 ppm 以下に調整した。

〒11 1 電振巡の如台五が定殿を伸

Table I 電灯俗の組成及び表映采件		
組成	濃度 (mol/L)	
$ZnSO_4 \cdot 7H_2O$	0.52	
Al(SO ₄) ₃ ·14-18H ₂ O	0.079	
添加剤	添加量 (g)	
HDPC	$0 \sim 1.5$	
条件		
pH	2.5	
温度 (℃)	60	
電位 (V)	-2.5 ~ -1.1	
N ₂ バブリング	60 min.	



Benzethonium Chloride C27H42CINO2: 448.081



Fig.1 各第4級アンモニウム塩の構造

結果および考察

Fig.2に第4級アンモニウム塩である HDPC を添加した際の添加剤の量におけるアルミニ ウムの含有量を示した。添加剤の量の増加に伴 いアルミニウムの含有量が増加し、アルミニウ ムの含有量の最大が 1.5 g/L 添加した際, -1.7 V で 5.97%であった。



Fig.2 添加剤HDPC量におけるAI含有量 A) 1.5 g/L添加した際の-1.7 V B) 1.0 g/L添加した際の-1.7 V C) 添加剤無しでの-1.9 V

Fig. 3 に Fig. 2 での各 HDPC 量におけるアル ミニウム含有量の多いA、B、C条件でのSEM 像を示した。添加剤の量の増加に伴い亜鉛の六 角板の結晶が崩れ、粒子状の結晶が見られた。



Fig.3 各HDPC 量におけるアルミニウム含有量 の多い条件での SEM 像

Fig.4に TEM での断面図を示した。基板から1 μm 付近及び 1 μm 付近から電析では異なる 形状の電析表面となった。



Fig.4 透過型電子顕微鏡における断面形状

Fig. 5 に透過型電子顕微鏡による元素組成デー タを示した。棒状の析出が見られる D 領域では 亜鉛が多く含まれていたが、極微粒子の析出が 見られるE領域では、D領域と比べアルミニウ ムの含有量が多い結果となった。この結果から アルミニウムは極微粒子として基板に電析し たと考えられる。また、SEM の結果による添加 剤の添加量の添加量に伴い確認された極微粒 子の結晶はアルミニウムだと考えられる。



Fig.6 透過型電子顕微鏡での元素組成データ

Table.2 D領域での透過型電子顕微鏡による 元素組成データ

各元素	Weight %	Atomic %
0	4.40	15.70
Al	0.80	17.0
Zn	94.80	82.60

Table.3 E領域での透過型電子顕微鏡による 元素組成データ

各元素	Weight %	Atomic %
0	7.80	20.60
Al	18.60	29.20
S	3.40	4.50
Zn	70.20	45.60

4. 謝辞

本研究の一部は平成 24 年度採択文部科学省 私立大学戦略的研究基盤形成支援事業の研究 として実施されたものである。

文献

1) 大上悟, 中野博昭, 小林繁夫, 秋山徹也, 福島久哲,奥村和生;表面技術,53,920 (2002).

OK. Chokki, A. Yamamoto, M. Ueno, M. Suzuki, Y. Yamamoto, N. Watanabe, I. Koiwa